

488696-2026 - Konkursas

Airija – Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Prekės

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Education Procurement Service (EPS)

E. paštas: info@educationprocurementservice.ie

Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Aprašymas: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Procedūros identifikatorius: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): South-East (IE052)

Šalis: Airija

2.1.3. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.5. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 4

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Aprašymas: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork.

The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): South-East (IE052)

Šalis: Airija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 48 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: anglų kalba

Kalbos, kuriomis neoficialiai skelbiami pirkimo dokumentai (ar jų dalys): anglų kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: anglų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: The High Court of Ireland

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: The High Court of Ireland

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002

Pavadinimas: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Aprašymas: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Vidaus identifikatorius: 2

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): South-East (IE052)

Šalis: Airija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 48 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: anglų kalba

Kalbos, kuriomis neoficialiai skelbiami pirkimo dokumentai (ar jų dalys): anglų kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio

Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: anglų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas,

Vakarų Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: The High Court of Ireland

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: The High Court of Ireland

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003

Pavadinimas: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Aprašymas: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Vidaus identifikatorius: 3

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): South-East (IE052)

Šalis: Airija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 48 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: anglų kalba

Kalbos, kuriomis neoficialiai skelbiami pirkimo dokumentai (ar jų dalys): anglų kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: anglų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: The High Court of Ireland

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: The High Court of Ireland

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0004

Pavadinimas: Plasma Deposition ,PECVD

Aprašymas: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Vidaus identifikatorius: 4

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): South-East (IE052)

Šalis: Airija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 48 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: anglų kalba

Kalbos, kuriomis neoficialiai skelbiami pirkimo dokumentai (ar jų dalys): anglų kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: anglų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: The High Court of Ireland

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: The High Court of Ireland

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Education Procurement Service (EPS)

Registracijos numeris: IE 6609370 G

Pašto adresas: Castletroy Limerick

Miestas: Limerick

Pašto kodas: V94 DK53

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Mid-West (IE051)

Šalis: Airija

E. paštas: info@educationprocurementservice.ie

Telefono numeris: 000

Interneto adresas: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Pirkėjo profilis: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: The High Court of Ireland

Registracijos numeris: The High Court of Ireland

Padalinys: The High Court of Ireland

Pašto adresas: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Miestas: Dublin

Pašto kodas: D07 WDX8

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Dublin (IE061)

Šalis: Airija

E. paštas: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefono numeris: +353 1 8886000

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: European Dynamics S.A.

Registracijos numeris: 002024901000

Padalinys: European Dynamics S.A.

Miestas: Athens

Pašto kodas: 15125

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Šalis: Graikija

E. paštas: eproc-esender@eurodyn.com

Telefono numeris: +30 2108094500

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Pagrindinė pakeitimo priežastis

:

Atnaujinta informacija

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: anglų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 488696-2026

OL S numeris: 134/2026

Paskelbimo data: 15/07/2026